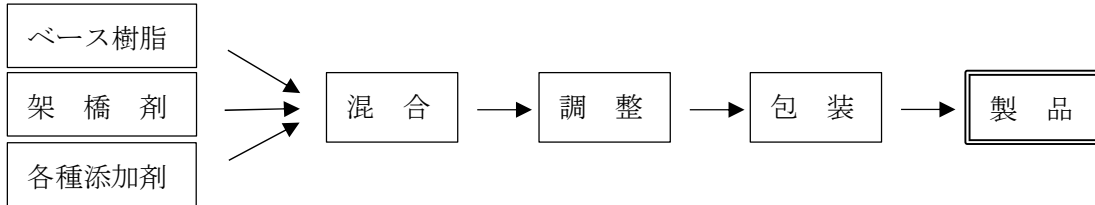


## 1. ネガ型レジストの製法

### (1) 組成

- ベース樹脂 : ノボラック樹脂、PHS（パラヒドロキシスチレン）樹脂、アクリル樹脂等
- 架橋剤 : アルキル化メラミン樹脂、アルキル化尿素樹脂等
- 酸発生剤 : トリアジン系化合物、オニウム塩系化合物
- 各種添加剤 : 粘度調整剤、レベリング剤等

### (2) 製法概略



## 2. 電子材料商品の応用分野

### (1) フォトリソレジスト（用途：レジストインキ、液状レジスト、ドライフィルム）

- ネガ型レジスト用架橋剤
  - メラミン系架橋剤（i-線より長波長領域）
    - ニカラック MW-30HM、ニカラック MW-100LM
    - ニカラック MX-750LM
  - 尿素系架橋剤（エキシマ領域）
    - ニカラック MX-290、ニカラック MX-280
    - ニカラック MX-270
- 光酸発生剤
  - トリアジン系酸発生相（i-線領域）
    - MP-トリアジン、TFE-トリアジン、TME-トリアジン
    - ジメトキシトリアジン
  - オニウム塩系酸発生剤（エキシマ領域）
    - IBPF、IBCF、TS-01、TS-91
- 乱反射防止剤（紫外線吸収剤）—— クルクミン

### (2) 基盤用レジスト

- ネガ型レジスト用架橋剤 —— メラミン系架橋剤（工業塗料用架橋剤と同一商品）
  - ニカラック MW-30M、ニカラック MW-30
  - ニカラック MW-100
- 光酸発生剤 —— トリアジン系酸発生剤
  - MP-トリアジン、TFE-トリアジン、TME-トリアジン

### (3) 感光性樹脂用凸版剤

- 光酸発生剤 —— トリアジン系酸発生剤
  - MP-トリアジン、TME-トリアジン

### (4) PS 版材・フレキソ版材

- 光酸発生剤
  - トリアジン系酸発生相（i-線領域）
    - MP-トリアジン、TFE-トリアジン、TME-トリアジン
  - オニウム塩系酸発生剤（エキシマ領域）
    - IBPF